PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-104062

(43) Date of publication of application: 22.05.1986

(51)Int.CI.

C23C 4/18

(21)Application number : 59-222807

(71)Applicant: TSUKISHIMA KIKAI CO LTD

(22)Date of filing:

23.10.1984

(72)Inventor: NOMURA TAKESHI

SHOJI HIDEO

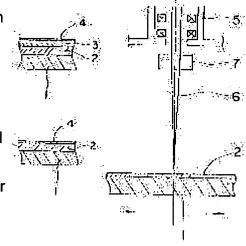
TAKAHASHI YOSHINORI

(54) METHOD FOR SEALING PORE OF METALLIC OR CERAMIC THERMALLY SPRAYED COATED FILM

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve further various characteristics by sealing pores formed in the film by remelting when the film having resistance to heat, corrosion, and abrasion is formed on the surface of a base material by spraying thermally metals or ceramics.

CONSTITUTION: A metal or an alloy 2 such as W, Ta, Mo, Ni-Cr, and Co-Cr having resistance to heat, corrosion, and abrasion is thermally sprayed on the surface of a base material 1 made of metals, nonferrous metals, or nonmetals, after the surface is roughed by sandblasting, chemical treatment, etc. Or ceramic powder such as alumina, zirconia, chromium oxide, and titanium oxide having excellent resistance to corrosion, heat, and abrasion or the ceramic powder mixed with metallic powder is thermally sprayed to form a film 3. Since many pores



are present in the thermally sprayed films 2 and 3, a vacuum or local vacuum electron beam or a laser beam 6 is irradiated to remelt the thermally sprayed layer and to seal the pores, and said characteristics are further improved.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]...

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭61 - 104062

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)5月22日

C 23 C 4/18

7011-4K

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

公発明の名称 金属またはセラミツク溶射被膜の封孔処理方法

②特 願 昭59-222807

威

雄

②出 願 昭59(1984)10月23日

の発明者 野村の発明者 庄司 秀の発明者 高橋 夢

東京都中央区価2丁目17番15号 月島機械株式会社内 東京都中央区価2丁目17番15号 月島機械株式会社内

東京都中央区価2丁目17番15号 月島機械株式会社内

則 東京 社 東京

人 月島機械株式会社 大 弁理士 荒垣 恒輝 東京都中央区佃2丁目17番15号

明 細 有

/発明の名称 金属またはセラミック溶射被膜 の封孔処理方法

2.特許額求の範囲

四代 理

- / 金属、 非鉄金属または非金属の 母材の長面 にブラスト処理または化学的処理を施し、 ついてその上に耐熱性、耐食性または耐摩性を属の一種または複数種組合わせたものを帮射した後、 生成した 表層 被験を実空式または局部真空式電子 ビーム若しくはレーザビームにより再溶験して封孔することを特徴とする封孔処理方法。
 - 2 金魚、非鉄金属または非金属の母材の表面 にプラスト処理または化学的処理を施し、ついてその上に耐熱性、耐食性または耐寒性金 風の一種または数種組合わせたものを溶射した さらにその上に耐熱性、耐食性また耐燥性セ ラミック粉末またはセラミック粉末と金属の 末とを混合したものを溶射した彼、生成 安層被膜を真空式または局部真空式電子

ムまたはレーザビームにより再辞触して封孔 することを特徴とする封孔処理方法。

3発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、母材(ベースメタル)上に金属また はセラミックを溶射して耐熱性、耐食性または耐 歴性被膜を形成する際に生ずる気孔を對止し、溶 射物の耐熱性、耐食性または耐摩性を一層改善す る方法に関する。

従来の技術

金属、非鉄金属または非金属の母材の耐熱性、耐食性または耐摩性を改善するため、母材上に目的に応じて通当な金属またはセラミックを溶射し それらの材料に保験被膜を形成することは従来か ら広く行なわれている。

従来の母材に依能被膜を付与する処理技術、たとえば溶射技術は、母材の袋面にブラスト処理または化学的処理等の前処理を施し、然る後金嶌またはセラミックをブラズマまたはガス溶射法によって溶射するか、或は母材に対する感傷拳を回避

特開昭61-104062 (2)

するためあらかじめ密射された金属層の上にさら にセラミック或は金属とセラミックを混合溶射す るものであつた。

ところが、このような商射方法では商射被膜に 気孔の発生が避けられない。すなわち、母材上に 耐熱性、耐食性または耐原性被膜を形成する場合、 上記の目的に適した材料の粉末が例えばプラズマ 等の番射等により母材上に溶射されると、粉末は 群融しながら母材に到達し、溶散材料は「ヌレー すなわち母材表面の凹凸部に流れついて固定し、 固化して鱗状となり、層状となるように溶射処理・ が行なわれて、被膜を形成する。そして、溶融し た材料が母材に到達したとき、両者の境界面に嵌 化物を生じ、この彼化物は熱分解して原子状から 分子状に変成し、その際気泡を発生し、その気泡 は被膜内部に對入される。そして一部の気泡は上 下に開口、連通して被膜表面から母材に連する気 孔となり、他の一部は、上方へ開放して凹部を生 成し、これが孔部を形成する。このようを気孔は、 啓射物が製品となつて使用されるとき、 そこから

屋性の点で使用環境の制限を避けられない。 発明が解決しようとする問題点

本発明は、母材上の溶射金属またはセラミック被膜に生じた気孔を有効に對止すると共に、気孔の對止によつて溶射物から作つた製品の使用範囲を狭めることのない金属またはセラミック溶射被膜の對孔処理方法を提供する。

間触点を解決するための手段および作用

液体またはガス体の侵入を肝す。もしその製品が腐食性高温酸化性または還元性雰囲気で使用される場合、侵入した液体またはガス体により母材に換傷を生じ、溶射被膜はその目的を十分に達成することができない。そこで、気孔に溶験材料を注入してこれを封止することが必要になる。

客施例

以下図面を参照し、実施例に基づいて本発明を 説明する。

第2図(a) および第2図(b) は、本発明の封孔処理 方法が施された二種類の金属またはセラミック
移物の断面構造を示し、1は母材(ベースメタル)、2は溶射された金属被膜、3はさらにその上 に溶射されたセラミックまたはセラミックと金属 の混合物の被膜、4は封孔被腹層である。

特開昭61-104062 (3)

との混合物を溶射したものである。4は、以下に 説明するように、真空式または局部真空式電子ビ ・ ームまたはレーザビームにより被膜2または3の 上を掃引(スウイーブ)することにより再溶験させる個、すなわち對孔被膜櫓である。

第1図(a) および第1図(b) は、電子ビーム発生装置を用いて封孔処理する方法、第3図は封孔処理された板状の溶射物を示す。

5 は電子ビーム発生装置で、個向機構 7 を具え、発生したビーム 6 は個向機構により左右に、例えば、0.01 ~ 15000 Hz の振動数で振られる。電子ビーム発生装置 5 の真下に置かれた溶射物は、左右に振られるビーム面に対して直角に反復して送られる。その結果溶射物(板)の表面には平行した帯状の模様が現われる。

第4回は棒状ないし質状溶射物8の封孔処理方 佐を示す。

になる。

例をは、 Ra Ce、 Sox 等の腐敗が、 Ra Ce、 Sox 等の腐敗が、 Ra Ce、 Sox 等の腐敗が、 Ra Ce、 Sox 等の腐敗が、 Ce では、 Too では、 Co では、

《図面の簡単な説明

第1図(a) および第1図(b) は本発明方法を與施する装成の練図的説明図、第2図(a) および第2図(b) は本発明方法によつて処理された容射物の断面図、

られて全長に亙つて処理される。

また、特殊な形状の密射物の場合もとれに単じ て對孔処理がなされる。

なお上記いずれの場合でも、ビームの焦点を表 層被膜材料に合わせるようにすることによりに ムのもつエネルギを十分利用することができる。 レーザとして CO_® ガスレーザも使用しうる。また、 ビームのエネルギの一部は表層被膜の下の本被膜 にも及ぶが、表層被膜材料に比し熱容量が大きい ため再溶融しても結果的に損傷とはならない。 発明の効果

本発明の封孔処理方法は、上記のように構成されているので、大エネルギの電子ピームまたに生む、できたに生り、溶射時に生に力を集中することにより、溶射時を生に立た気孔に対してセラミンクや超耐高温材料を形成して有効に対止し、それらが封孔を完全に除るし、従来の溶射物の欠点である気孔を完全に除ますることがないので、溶射物の使用範囲を従来より飛幅的に拡大することが可能

第3図は同じく板状体の斜視図、第4図は智また は棒状体に対する処理方法を示す斜視図である。

1 ... 母材 2 ... 格射金属被膜

5 ... 電子ピーム発生装置

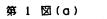
6 ... 包子ピーム 7 ... 偏向機存っ

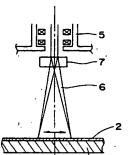
代理人 荒 垣 恒 蝉

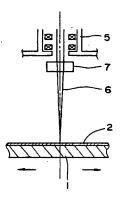
特開昭61-104062 (4)

第2回(0)

第 2 図(b)







第 1 図(b)

